AgInZnO スペーサー層を用いたホイスラー合金 CPP-GMR 素子

中谷 友也、佐々木 泰祐、桜庭 裕弥、宝野 和博 (物質·材料研究機構)

CPP-GMR devices using Heusler alloy and AgInZnO spacer layer Tomoya Nakatani, Taisuke Sasaki, Yuya Sakuraba, Kazuhiro Hono (National Institute for Materials Science)

はじめに

ホイスラー合金を強磁性層に用いた面直電流巨大磁気抵抗(CPP-GMR)素子は、低素子抵抗かつ比較的大きな磁気抵抗(MR)出力のため、高記録密度ハードディスクドライブの再生ヘッドセンサや、高感度磁気センサへの応用が期待される。非磁性スペーサー層に Ag/InZnO など金属と酸化物の積層膜を用いることで、MR 比の増大が報告されており[1]、さらなる MR 出力の改善のためにスペーサー層の材料開発が重要である。本研究では AgInZnO をスペーサー層に用いた CPP-GMR 素子を作製し、磁気抵抗特性と微細構造を調査した。

実験方法

マグネトロンスパッタリングにより、多結晶擬スピンバルブ膜を作製した。積層構造は Cu 電極/Ta(2)/Ru(2)/CoFe(0.5)/CoFeBTa(1.5)/CoFe(0.4)/AgInZnO(1.2)/CoFe(0.4)/CMFG(5)/CoFeBTa(1.5)/Ru(8) (膜厚は nm) であり、成膜後に $280\,^{\circ}$ C で $3\,h$ の熱処理をおこなった。CMFG は $Co_2(Mn_{0.6}Fe_{0.4})$ Ge ホイスラー合金であり、AgInZnO は Ag と InZnO (In_2O_3 10 wt. %–ZnO 90 wt. %の混合体)の同時スパッタリングにより成膜した。AgInZnO 中の Ag の公称濃度は 20-36 at. %である。比較のため、Ag $_{90}$ Sn $_{10}$ ($3.5\,$ nm)スペーサー、Ag($0.4\,$ nm)/InZnO(1.3- $1.75\,$ nm)スペーサーを用いた CPP-GMR 素子を作製した。

実験結果

図 1 に CPP-GMR 素子の室温における素子抵抗×面積 (RA)と MR 比 ($\Delta R/R$)を示す。AgInZnO スペーサーを用いた素子では、AgInZnO 中の Ag 濃度の増加とともに $\Delta R/R$ と RA が減少し、Ag₉₀Sn₁₀ スペーサーを用いた全金属 CPP-GMR 素子の値 (RA = 0.03 Ω μ m², $\Delta R/R$ = 18%) に漸近する。RA > 0.2 Ω μ m² の領域で $\Delta R/R$ ~60%、RA = 0.08 Ω μ m² において $\Delta R/R$ ~50%という高い MR 比が多結晶薄膜を用いて実現される。これは面記録密度 5 Tbit/in² に要求される RA と $\Delta R/R$ の値[2]を満足しており、次世代の再生ヘッドセンサとして有望である。一方、Ag/InZnO 2 層 スペーサーを用いた場合では、MR 比が最大で 35%と AgInZnO スペーサーに比べ低い値しか得られない。

図2に走査透過電子顕微鏡でのエネルギー分散型 X線分析法による、CPP-GMR 膜内の元素分布を示す。元来 Mn は CMFG

層にしか存在しないはずであるが、スペーサー内に高濃度のMnとOが見られた。電子回折図形からこれは岩塩構造のMnOであることがわかった。一方、 In_2O_3 は還元され、AgIn合金を形成している。AgInは部分的に上下のCMFG間をつなぐパスを形成しており、電流が狭窄して流れるために大きなMR比が得られるのであると考えられる。

<u>参考文献</u> [1] Nakatani *et al.* IEEE Trans. Magn. 54, 3300211 (2018). [2] Takagishi *et al.* IEEE Trans. Magn. 46, 2086 (2010).

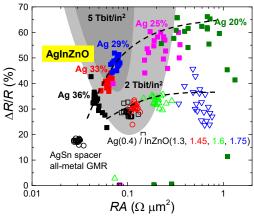


図 1 CPP-GMR 素子の *RA* と MR 比の分布。再生ヘッド要求値は文献[2]より引用。

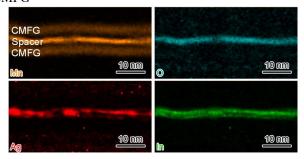


図 2 AgInZnO スペーサーを用いた CPP-GMR 膜中における Mn, O, Ag および In の分布。